

第3回ミニワークショップ報告

日時： 2010年2月24日（木） 13:00～17:20
場所： 三番町ビル1F 第3会議室
出席者： 佐藤研究総括
五明 AD、高梨 AD、波多野 AD、藤巻 AD
浜屋研究者（話題提供者）、福村研究者（話題提供者）
齊藤研究者、白石研究者、谷山研究者、村上研究者、中岡研究者、
水落研究者、西永研究者、山本研究者
横田主査、泉技術参事、前田技術参事

プログラム

1. 開会の挨拶（佐藤総括）
2. 話題提供および質疑、討論（話題提供者：浜屋研究者）
3. 話題提供および質疑、討論（話題提供者：福村研究者）
4. 総評（佐藤総括）

詳細

1. 研究討論に先立ち、佐藤総括より新たな受賞者や昇任、異動される研究者の紹介があった。また、これまでのミニワークショップの経緯として、第1回は事務局で企画したが2回目からは研究者からの提案に基づいて計画していると説明があった。さらに、4月からすべての研究者がそろふことから、ホームページに領域のニューズレターのページを作ったことを紹介した。積極的に投稿していただくように要請があった。
2. 浜屋研究者から、シリコンスピントロニクス現状と室温スピン伝導についての話題提供をしていただいた。具体的には、シリコンスピントロニクスの歴史的経緯と浜屋研究者が取り組んでいる Fe_3Si の問題点について詳細な説明があった。
3. 福村研究者から、磁性半導体についての紹介と研究されている Co ドープ TiO_2 についての話題提供があった。Co ドープ TiO_2 は 600K を越える T_C で高温強磁性半導体である。デバイス応用を考えており、電界制御強磁性半導体や、電気二重層トランジスターの紹介があり、スピントロニクス以外の応用についても議論がなされた。
4. 総括から全体的なコメントをいただいた。次回の領域会議や、5月に予定している第4回ミニワークショップについても紹介があり、今後も活発な討論を期待しているとのことであった。